

锂双原子分子激光感生荧光谱的分析与研究

金 凤 马祖光

(哈尔滨工业大学激光教研室)

首次报道了以 He 及 Ar 作为缓冲气体时, 在 351.1 nm XeF 及 337.1 nm N₂ 脉冲紫外激光泵浦下, 得到在锂蒸汽激光感生荧光谱中的 500~600 nm 新谱区, 并对这个新谱区以及同时观察到的 B\Pi u-X'\Sigma_g^+ 带中的 450~520 nm 波段和 500~600 nm 波段进行了分析与讨论, 给出了蒸汽中可能存在的动力学过程。同时, 初步探讨了产生这个新谱区的上、下能级。文中还报道了用 308 nm XeCl 紫外激光激励香豆素 102 染料获得的 474 nm 附近的激光线(如 470 nm、478 nm 等)作为泵浦源泵浦 Li 蒸汽, 得到 520 nm、580 nm 等几条超辐射线。

SOI 结构激光再结晶薄层中应力的喇曼光谱研究

冷静民 钱佑华

(复旦大学物理系)

林成鲁 方 芳

(中国科学院上海冶金研究所离子束开放实验室)

在电阻率为 6~8 Ω·cm 的 N 型 <100> 硅衬底上热生长 1 μm 厚的 SiO₂ 层, 用 LPCVD 方法淀积 0.5 μm 厚的多晶硅层, 然后用束斑直径为 40 μm、功率为 5 W 的 Ar⁺ 激光束对样品再结晶, 激光扫描速率为 5 cm/s, 衬底温度为 550°C。在上述条件下, SOI 薄层发生了熔化并再结晶的过程。在这一过程中, 由于 SiO₂ 绝缘层的热膨胀系数比硅小很多, 因此 SOI 薄层受到张应力, 其大小估算为 8×10^8 Pa。我们采用喇曼光谱方法测量了该应力。实验发现, 再结晶后的 SOI 样品的一级光学声子峰 O(Γ) 与单晶硅的一级光学声子峰 O(Γ) 相比, 峰值位置从 521.20 cm⁻¹ 移到了 517.60 cm⁻¹, 证实存在着张应力。从求解晶格动力学方程得出: 当频移量达 3.6 cm⁻¹ 时, 其所受的张应力为 9×10^8 Pa, 与我们的估算结果符合得较好。